

## ТЭЙЛОРОВСКАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ТОНКОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ

*Ю.А.Башилов, С.В.Покровский*

В работе получено точное решение задачи о движении тонкой цилиндрической оболочки под действием внешнего давления. Показано, что при сжатии развиваются неустойчивости тэйлоровского типа, которые не могут быть стабилизированы вращением. Получен спектр возбуждений плоской пленки в поле тяжести с учетом поверхностного натяжения.

Для получения металлического водорода, сверхсильных магнитных полей и для термоядерного синтеза предлагалось использовать лайнер [1 — 3]. Он представляет собой тонкостенный металлический цилиндр, сжимаемый нарастающим во времени магнитным полем. При сжатии лайнера развиваются неустойчивости тэйлоровского типа. Экспериментально наблюдалось, что лайнер становится после сжатия в продольном поле цилиндром, гофрированным параллельно оси [4]. Другие моды неустойчивости связаны с изгибанием силовых линий. Поэтому продольные неустойчивости имеют значительное энергетическое преимущество перед остальными [1].

В работе исследовано развитие такого типа неустойчивости при произвольных амплитудах. Аналогичное исследование для плоской поверхности выполнено в работе [5]. В данной работе также разобрано в линейном приближении влияние поверхностного натяжения на спектр возбуждений тонкой пленки.

Зададим поверхность параметрически:  $r(\psi, t)$ . Здесь  $t$  — время, а  $\psi$  — лагранжева координата, от которой  $r$  зависит циклически. Элемент массы

$$dm = \rho d\psi,$$

где  $2\pi\rho$  — масса единицы длины цилиндра. Уравнение движения имеет вид:

$$\rho \ddot{r} = p[k, r']. \quad (1)$$

Здесь  $k$  — орт вдоль оси цилиндра,  $p$  — внешнее давление, а штрих означает дифференцирование по  $\psi$ .

Подстановкой

$$Z = x + iy = r e^{i\phi}, \quad (2)$$

где  $x, y$  — декартовы, а  $r, \phi$  — полярные координаты, оно приводится к виду

$$\rho \ddot{Z} = i p(t) Z'. \quad (3)$$

Рассмотрим три временных режима давления: 1) постоянное давление  $p = \rho a^2 = \text{const}$ ; 2) импульсный режим  $p = \rho a \delta(t)$ ; 3)  $p = \rho a t^{-2}$ . Последний случай интересен потому, что он соответствует степенным режимам сжатия оболочки конечной толщины [6]. Во всех трех случаях исследуется движение круглого цилиндра, искаженного  $k$ -й гармоникой. Начальные условия задаются в виде

$$Z(\psi, t_0) = e^{i\psi} - \frac{\mu}{k} e^{ik\psi}, \quad (4)$$

$$\dot{Z}(\psi, t_0) = 0, \quad (5)$$

где  $|\mu| < 1$ . В первых двух случаях полагается  $t_0 = 0$ . Тогда

$$Z(\psi, t) = R(t) \left[ e^{i\psi} - \frac{\mu(t)}{k} e^{ik\psi} \right].$$

При  $|\mu(t)| > 1$  кривая становится самопересекающейся. Поэтому естественно считать, что пленка живет до момента времени  $t^*$  такого, что  $|\mu(t^*)| = 1$ . Может, однако, иметь место ситуация, когда круглый цилиндр схлопывается раньше. Время схлопывания  $t_{col}$  определяется уравнением  $R(t_{col}) = 0$ . В таком случае считаем движение устойчивым.

Обычная тэйлоровская неустойчивость плоской поверхности развивается с образованием длинных и узких выступов в сторону избыточного давления, чередующихся с неглубокими широкими впадинами. Такого типа неустойчивости есть и на цилиндре. Им соответствуют отрицательные  $k$  в формуле (4). Если  $|k| \gg 1$  и  $e^{-\sqrt{|k|}} \ll \mu < 1$ , то  $t^* \ll t_{col}$ . Для рассматриваемых режимов давления приближенное ре-

шение уравнения  $\mu(t^*) = 1$  дает:

$$1) t^* = \frac{1}{\sqrt{a|k|}} \ln\left(\frac{1}{\mu} + \sqrt{\frac{1}{\mu^2} - 1}\right), \quad t_{col} = \pi/2\sqrt{a} \quad (\text{постоянное давление});$$

$$2) t^* = \frac{1-\mu}{1+\mu|k|} \frac{1}{a}, \quad t_{col} = \frac{1}{a} \quad (\text{эта и следующая формулы для импульсного режима точные});$$

$$3) t^* = t_0(1-\tau), \quad \text{где} \quad \tau = \frac{1}{\sqrt{a|k|}} \ln \frac{\frac{1}{\mu} + \sqrt{\frac{1}{\mu^2} - 1} + \frac{1}{4a|k|}}{1 + (4a|k|)^{-1/2}}$$

Здесь  $a|k| \gg 1$  (степенные режимы).

Здесь надо оговорить, что в третьем случае интересны режимы возрастания давления, что соответствует движению по времени от  $t_0 < 0$  до 0. Можно, однако, работать с положительными временами, двигаясь от  $t_0 > 0$  до 0. Именно поэтому положено  $t^* = t_0(1-\tau)$ . Кроме описанной неустойчивости у цилиндра существует другой тип неустойчивости, отсутствующий у плоской поверхности. Ему соответствуют положительные  $k$  в формуле (4). Развиваются узкие выступы, направленные внутрь цилиндра, чередующиеся с широкими впадинами. Заметим, что линейное приближение не дает никакой информации о неустойчивости такого вида. Время жизни в этой ситуации также может быть мало, если амплитуды  $\mu$  близки к единице, а  $k$  — велики.

$$1) t^* = \pi/\sqrt{ak} \quad \text{при} \quad 1-\mu < \pi^2/2k \quad \text{и} \quad k \gg 1;$$

$$2) t^* = \frac{1+\mu}{1+\mu k} \frac{1}{a} \quad \text{при} \quad k \gg 1;$$

$$3) \tau = 1 - \frac{t^*}{t_0} = \frac{\pi}{\sqrt{ak}} \quad \text{при} \quad 1-\mu < \frac{\pi}{2\sqrt{ak}} \quad \text{и} \quad k \gg a + \frac{1}{a}.$$

Высказывались предположения о возможности стабилизации линейра относительно тэйлоровской неустойчивости вращением [7, 8]. Здесь рассмотрен этот вопрос для тонкостенного цилиндра в случае постоянного давления.

Считаем, что в начальный момент цилиндр вращается с угловой скоростью  $\Omega$ , имея нулевую радиальную скорость. При этом условия (5) заменяются на

$$Z(\psi_0) = i\Omega Z(\psi, 0). \quad (6)$$

Тогда

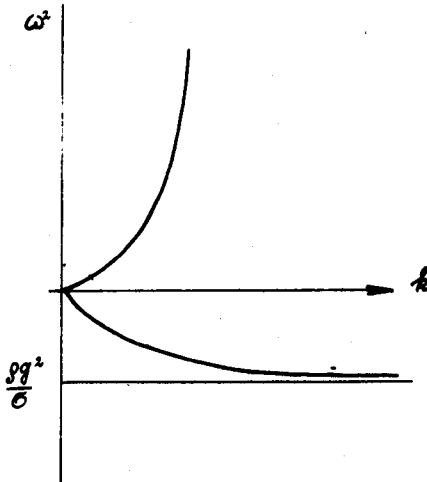
$$Z(\psi, t) = R(t) \left[ e^{i(\psi + \alpha(t))} - \frac{\mu(t)}{k} e^{i(k\psi + \beta(t))} \right].$$

$R(t)$  при  $\Omega \neq 0$  не обращается в ноль, т. е. схлопывания нет. Как и раньше, условие  $\mu(t^*) = 1$  определяет время жизни  $t^*$ . Оказывается, что в диапазоне  $\sqrt{a'} < \Omega < \sqrt{a'k}$  стабилизируются моды с  $k > 1$ , но моды с  $k < 0$  по-прежнему неустойчивы. Полный разбор со всеми формулами будет дан в более подробной статье.

Рассмотрим теперь влияние поверхностного натяжения на устойчивость пленки. Пусть плоская пленка находится в поле тяжести и поддерживается снизу давлением  $p = \rho g$ , где  $\rho$  — линейная плотность,  $g$  — ускорение свободного падения. Параметрическое задание поверхности есть  $r = r(\xi, t)$ . Уравнение движения имеет вид

$$\ddot{r} = \frac{\sigma}{\rho} \frac{[r, [r'', r']]}{|r'|^3} + g[r', j] - gk. \quad (7)$$

Здесь  $\sigma$  — двусторонний коэффициент поверхностного натяжения пленки;  $(i, j, k)$  — неподвижная тройка ортов, а штрих означает дифференцирование по  $\xi$ . За первый член в правой стороне (7) ответственно поверхностное натяжение, за второй — сила давления, а за третий — сила тяжести.



Линеаризуя (7) вблизи равновесного решения  $r = \xi i$ , получаем спектр возмущений (рисунок):

$$\omega^2 = \frac{1}{2\rho} \left( \sigma k^2 \pm \sqrt{\sigma^2 k^4 + 4\rho^2 g^2 k^2} \right).$$

Таким образом видно, что при всех  $\sigma$  существует неустойчивая мода в отличие от случая слоя жидкости конечной толщины. Это объясняется тем,

что всегда существуют точки перегиба, где вторая производная по  $\xi$  равна нулю. В этих точках поверхностное натяжение не работает, а силы давления и тяжести не совпадают по направлению. В этих точках и развивается неустойчивость.

Мы благодарны С.И.Анисимову за предложенную тему и многочисленные ценные обсуждения.

Институт теоретической физики  
им. Л.Д.Ландау  
Академии наук СССР

Поступила в редакцию  
26 февраля 1976 г.

### Литература

- [1] E.G.Harris. Phys. Fluids, 5, 1057, 1962.
  - [2] R.S.Hawke, et al. Nature Phys. Sci., 233, 79, 1971.
  - [3] R.S.Hawke, D.E.Duerre, J.G.Huebel, H.Klapper, D.I.Steinberg. Appl. Phys., 43, 2734, 1972.
  - [4] J.M.Okada, D.C.de Pakch. Bull. Am. Phys. Soc., 17, 1005, 1972.
  - [5] E.Ott. Phys. Rev. Lett., 29, 1429, 1972.
  - [6] К.В.Брушлинский, Я.М.Каждан. УМН, 18, 3, 1963.
  - [7] A.Bareilon, D.L.Book, A.L.Cooper, JPF, 17, 1707, 1974.
  - [8] D.L.Book, N.K.Winsor. JPF, 17, 662, 1974.
-